

300mm 対応ランプアニール装置

Rapid Thermal Processing System for \cup 300mm

大口径化・微細化が進む半導体業界において、日本国内の 300mm ラインも本格化してきた今、当社では長年にわたる経験を踏まえ 300mm 対応のランプアニール装置「RLA-3300」を開発しました。ランプアニール装置は雰囲気加熱ではなく、ハロゲンランプからの光エネルギーをウエハが吸収し温度を上げる仕組みであるため、昇温 250 / s・降温 90 / s という高速な熱処理が可能です。また、高速温度制御システムの採用や、独自のクロスランプ構造およびランプ配分(ゾーン構成)の細分化によるウエハ面内の均一化を向上し、多岐にわたる顧客の要求に応じていきます。

特長

- ・クロスランプ構造による優れた温度均一性
- ・高速温度制御システムの採用で高精度な処理が可能
- ・信頼性の高いウルトラクリーン搬送システム
- ・優れたコストパフォーマンス

仕様・性能

最高使用温度	1250
面内温度均一性	±2 (800 以上時)
最大昇温レート	250 / s
最大降温レート	90 / s

対応プロセス

- ・イオン注入後の活性化アニール
- ・ゲート酸化膜形成
- ・シリサイド形成

光洋サーモシステム株式会社